



① Veröffentlichungsnummer: 0 658 513 A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(1) Anmeldenummer: 94119307.0

(1) Int. Cl.⁶: C01B 33/16, C04B 30/00

(2) Anmeldetag: 07.12.94

Priorität: 14.12.93 DE 4342548

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 21.06.95 Patentblatt 95/25

Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE 1 Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Brüningstrasse 50 D-65929 Frankfurt am Main (DE)

2 Erfinder: Jansen, Rolf-Michael, Dr. Johann-Strauss-Strasse 18 D-65799 Kelkhelm (DE) Erfinder: Zimmermann, Andreas, Dr. im Dürren Kopf 27a D-64347 Griesheim (DE) Erfinder: Jacquinot, Eric 22, rue de la Fontaine St. Martin F-60350 Attichy (FR) Erfinder: Smith, Douglas M., Prof. 1412 Marquette PL NE Albuquerque, NM 87106 (US)

- Xerogele, Verfahren zu ihrer Herstellung, sowie ihre Verwendung.
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung modifizierter SiO2-Gele, "Xerogele" genannt, sowie die so hergestellten Xerogele selbst und deren Verwendung.

Die Xerogele werden dadurch hergestellt, daß man eine wäßrige Wasserglaslösung ansäuert, die dabei entstandene Kieselsäure durch Zugabe einer Base zu einem SiO2-Gel polymerisiert, mit einem organischen Lösungsmittel weitgehend das Wasser aus dem Gel auswäscht, dieses mit einem Silylierungsmittel umsetzt und dann bei -30 bis 200 °C und 0,001 bis 20 bar trocknet.

25

Die hergestellten Xerogele sind den üblichen SiO_2 -Aerogelen verwandt, aber nicht mit ihnen identisch.

selbst und deren Verwendung.

SiO2-Aerogele sind dafür bekannt, daß sie hervorragende Isolationswirkung besitzen. Sie werden beispielsweise durch saure Hydrolyse von Tetraethylorthosilikat in Ethanol hergestellt. Bei der Hydrolyse entsteht ein Gel, dessen Struktur durch die Temperatur, den pH-Wert und die Dauer des Gelierprozesses bestimmt ist. Jedoch kollabiert die Gelstruktur im allgemeinen bei der Trocknung der nassen Gele, da die bei der Trocknung auftretenden Kapillarkräfte extrem groß sind. Der Gelkollaps kann dadurch verhindert werden, daß die Trocknung oberhalb der kritischen Temperatur und des kritischen Druckes des Lösungsmittels durchgeführt wird. Da in diesem Bereich die Phasengrenze flüssig/gasförmig verschwindet, entfallen auch die Kapillarkräfte und das Gel verändert sich während der Trocknung nicht, d. h. es tritt auch kein Schrumpfen des Ges während der Trocknung auf. Auf dieser Trocknungstechnik basierende Herstellverfahren sind bekannt, z. B. aus EP-A-0 398 076 oder WO 92 03378. Diese Technik erfordert aber beispielsweise bei der Verwendung von Ethanol eine Temperatur über 240 °C und Drücke über 40 bar. Der Austausch von Ethanol gegen CO2 vor der Trocknung erniedrigt zwar die Trocknungstemperatur auf ca. 40 °C, der benötigte Druck liegt aber dann bei 80 bar.

Es wurde nun gefunden, daß man SiO₂-Gele bei unterkritischen Bedingungen trocknen kann (d.h. bei der Trocknung liegt eine Flüssigphase und eine Gasphase vor), wenn man sie vor der Trocknung mit einem Silylierungsmittel umsetzt. Die erhaltenen Produkte werden im folgenden als "Xerogele" bezeichnet. Sie sind hervorragende Wärmeisolationsmittel.

Ein Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Xerogelen, dadurch gekennzeichnet, daß man

- a) eine wäßrige Wasserglaslösung mit Hilfe eines sauren lonentauscherharzes oder einer Mineralsäure auf einen pH-Wert ≤ 2,2 bringt,
- b) die dabei entstandene Kieselsäure durch Zugabe einer Base zu einem SiO₂-Gel polymerisiert und, falls in Schritt a) eine Mineralsäure benutzt wurde, das Gel mit Wasser elektrolytfrei wäscht
- c) das in Schritt b) erhaltene Gel mit einem organischen Lösungsmittel solange wäscht, bis der Wassergehalt des Gels ≤ 5 Gew.-% ist,
- d) das in Schritt c) erhaltene Gel mit einem Silylierungsmittel umsetzt,

e) das in Schritt d) erhaltene silylierte Gel bei
 -30 bis 200 °C und 0,001 bis 20 bar trocknet.

In Schritt a) wird vorzugsweise ein saures lonentauscherharz eingesetzt; dabei sind vor allem solche geeignet, die Sulfonsäuregruppen enthalten. Falls man Mineralsäuren einsetzt, sind vor allem Salzsäure und Schwefelsäure geeignet. Als Wasserglas wird im allgemeinen Natrium- oder Kaliumwasserglas verwendet.

In Schritt b) wird als Base im allgemeinen NH₄OH, NaOH, KOH, Al(OH)₃ oder kolloidale Kieselsäure eingesetzt. Falls in Schritt a) eine Mineralsäure verwendet wurde, wird das mit Hilfe der Base erzeugte SiO₂-Gel mit Wasser elektrolytfrei gewaschen; vorzugsweise wird dabei solange gewaschen, bis das ablaufende Waschwasser dieselbe elektrische Leitfähigkeit hat wie entmineralisiertes Wasser.

Vor Schritt c) läßt man das Gel vorzugsweise altern, und zwar im allgemeinen bei 20 bis 90°C, vorzugsweise bei 20 bis 70°C, und einem pH-Wert von 6 bis 11, vorzugsweise 6 bis 9. Die Zeit dafür beträgt im allgemeinen 1 bis 48 Stunden, insbesondere 1 bis 24 Stunden.

In Schritt c) wäscht man das Gel vorzugsweise solange mit einem organischen Lösungsmittel, bis der Wassergehalt des Gels kleiner als 2 Gew.-% ist. Als Lösungsmittel werden im allgemeinen aliphatische Alkohole, Ether, Ester oder Ketone, oder aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe verwendet. Bevorzugte Lösungsmittel sind Methanol, Ethanol, Aceton, Tetrahydrofuran, Essigsäurerthylester, Dioxan, n-Hexan, Toluol. Man kann auch Gemische aus den genannten Lösungsmitteln verwenden. Man kann auch zuerst das Wasser mit einem Alkohol auswaschen und dann diesen mit einem Kohlenwasserstoff auswaschen.

Die Schritte a) bis c) werden im allgemeinen bei einer Temperatur zwischen dem Gefrierpunkt der Lösung und 70 °C durchgeführt.

In Schritt d) wird das lösungsmittelhaltige Gel mit einem Silylierungsmittel umgesetzt. Als Silylierungsmittel werden im allgemeinen Silane der Formeln R¹4-nSiCln oder R¹4-nSi(OR²)n mit n = 1 bis 3 eingesetzt, wobel R¹ und R² unabhängig voneinander C¹-C6-Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl sind. Auch Silazane sind geeignet. Vorzugsweise verwendet man Mono-, Di- oder Trimethylchlorsilan, Trimethylmethoxysilan oder Hexamethyldisilazan. Die Umsetzung wird im allgemeinen bei 20 bis 100°C, vorzugsweise 30 bis 70°C durchgeführt, wenn nötig in einem Lösungsmittel.

Vor Schritt e) wird das silylierte Gel vorzugsweise mit einem protischen oder aprotischen Lösungsmittel gewaschen, bis unumgesetztes Silylierungsmittel im wesentlichen entfernt ist (Restgehalt ≤ 1 Gew.-%). Geeignete Lösungsmittel sind dabei die bei Schritt c) genannten. Analog sind die dort 15

20

25

35

40

45

50

55

als bevorzugt genannten Lösungsmittel auch hier bevorzugt.

In Schritt e) wird das silylierte, und vorzugsweise danach gewaschene Gel bei Temperaturen von -30 bis 200 °C, vorzugsweise 0 bis 100 °C, sowie Drücken von 0,001 bis 20 bar, vorzugsweise 0,01 bis 5 bar, insbesondere 0,1 bis 2 bar, getrocknet. Höhere Temperaturen als 200 °C und/oder höhere Drücke als 20 bar sind ohne weiteres möglich, aber sie sind mit überflüssigen Aufwand verbunden und bringen keine Vorteile mit sich. Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, daß bei der Trocknung Temperaturen und Drücke genügen, die für die üblichen Lösungsmittel weit unter deren kritischen Temperaturen und Drücke liegen. Die Trocknung wird im allgemeinen so lange fortgeführt, bis das Gel einen Lösungsmittel-Restgehalt von weniger als 0,1 Gew.-% hat.

Die erfindungsgemäßen Verfahren soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Beispiel

1 I einer Natriumwasserglaslösung (mit einem Gehalt von 8 Gew.-% SiO2 und einem Na2O:SiO2 Verhältnis von 2:3) wurde zusammen mit 0,5 I eines sauren lonentauscherharzes (Styroldivinylbenzolcopolymer mit Sulfonsäuregruppen, handelsüblich unter dem Namen ®Duolite C20) gerührt, bis der pH der wäßrigen Lösung = 1,5 war. Anschließend wurde das Ionentauscherharz abfiltriert und die wäßrige Lösung mit 0.5 molarer NH4OH-Lösung auf einen pH von 4 eingestellt. Danach wurde das entstandene Gel noch 24 Stunden bei 50°C gereift und anschließend das Wasser mit 3 I Ethanol extrahiert. Aus dem so hergestellten Gel wurde das Ethanol mit 1,5 l n-Hexan bei 50°C extrahiert. Anschließend wurde das hexanhaltige Gel mit Trimethylchlorsilan (TMCS) silyliert (0,05 g TMCS pro Gramm nasses Gel), dann wieder mit 0,5 I n-Hexan gewaschen. Die Trocknung des Gels erfolgte an Luft (3 Stunden bei 40 °C, dann 2 Stunden bei 50 °C und 12 Stunden bei 150 °C).

Das so erhaltene, transparente Xerogel hatte eine Dichte von 0.13 g/cm³. Die spezifische Oberfläche lag bei 950 m²/g. Der λ -Wert lag bei 0.016 W/mk.

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Xerogelen, dadurch gekennzeichnet, daß man
 - a) eine wäßrige Wasserglaslösung mit Hilfe eines sauren Ionentauscherharzes oder einer Mineralsäure auf einen pH-Wert ≤ 2,2 bringt,
 - b) die dabei entstandene Kieselsäure durch Zugabe einer Base zu einem SiO2-Gel poly-

merisiert und, falls in Schritt a) eine Mineralsäure benutzt wurde, das Gel mit Wasser elektrolytfrei wäscht,

- c) das in Schritt b) erhaltene Gel mit einem organischen Lösungsmittel solange wäscht, bis der Wassergehalt des Gels ≤ 5 Gew.-% ist.
- d) das in Schritt c) erhaltene Gel mit einem Silylierungsmittel umsetzt,
- e) das in Schritt d) erhaltene silylierte Gel bei -30 bis 200 C und 0,001 bis 20 bar trocknet.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt a) ein saures lonentauscherharz einsetzt.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt b) als Base NH₄OH, NaOH, KOH, Al(OH)₃ oder kolloidale Kieselsäure einsetzt.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man das in Schritt b) erhaltene SiO₂-Gel bei 20 bis 90°C und einem pH-Wert von 6 bis 11 für eine Dauer von 1 bis 48 Stunden altern läßt, bevor man es in Schritt c) wäscht.
- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der pH-Wert 6 bis 9 beträgt.
 - Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Dauer 1 bis 24 Stunden beträgt.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt c) das Gel solange wäscht, bis sein Wassergehalt ≤ 2 Gew.-% ist.
 - 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt c) als organisches Lösungsmittel Methanol, Ethanol, Aceton, Tetrahydrofuran, Essigsäureethylester, Dioxan, n-Hexan oder Toluol einsetzt.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt d) als Silylierungsmittel Mono-, Di- oder Trimethylchlorsilan, Trimethylmethoxysilan oder Hexamethyldisilazan einsetzt.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man das in Schritt d) erhaltene silylierte Gel mit einem protischen oder aprotischen Lösungsmittel wäscht, bevor man es in Schritt e) trocknet.

3

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man in Schritt e) das silylierte Gel bei 0 bis 100 °C trocknet.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man das silylierte Gel in Schritt e) bei 0,01 bis 5 bar trocknet.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man das silylierte Gel in Schritt e) bei 0,1 bis 2 bar trocknet.
- 14. Xerogel, erhältlich nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13.
- 15. Verwendung des Xerogels nach Anspruch 14 als Wärmeisolationsmittel.

15

20

25

30

35

40

70

50

55

4



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 94 11 9307

		GE DOKUMENTE	 	
Kategorie	der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich, ichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	GB-A-682 574 (DOW * Beispiel 1 *		1,8,9	C01B33/16 C04B30/00
A	* Seite 3, Zeile 5	- Zeile 7 *	15	
A	Berlin, D E; Zusammenfassung Zusammen	BLATT, Nr. 20, 1965, Nr. 2187, *das ganze SL CHEM., Band 41, 1962, K ET AL.	1-3	
A	CHEMICAL ABSTRACTS 7. Oktober 1974, Co abstract no. 82740a Seite 328; * Zusammenfassung 3 & CS-A-152 568 (J.	olumbus, Ohio, US; a,	1-3	
A	DE-C-837 384 (ULTR/ OSWALD RAUDSZUS)	AKUST-GERÄTEBAU DRING.		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
				C01B C09C
Der vo		de für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort DEN HAAG	Abschliddersunder Recherche 29. März 1995	Dua	Prefer
X : van Y : van ante A : tech	ATEGORIE DER GENANNTEN i besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verhindung ren Veröffentlichung derseiben Kate adogischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung	OOKUMENTE T: der Erfindung 2 E: ülteres Patentdo tet nach dem Anne g mit einer D: in der Anneidu gorie L: 2123 andern Grit	egrunde liegende hument, das Jedocidedatum veröffen ig angeführtes Do nden angeführtes l	tlicht worden ist

PORM 1500 00.82 (Pe